

РАРАНСЬКИЙ М.Д., ФОДЧУК І.М., БОБРОВНИК С.В.

МОДЕЛЮВАННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ МУАРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕФЕКТІВ В КРЕМНІ

Представлені основні моменти теорії формування муарових зображень дефектів в трьохкристальній інтерферометрії. Використано ейкональне двохвильове наближення, в якому вектор дифракції є функцією просторових координат і відіграє роль повільно змінного показника заломлення в оптиці.

Рентгенівська інтерферометрія на даний час є дуже потужним засобом дослідження медичних та біологічних зразків у фазовій томографії. При цьому на якість інтерференційних зображень дуже суттєво впливають дефекти структури та макродеформації, які присутні в пластинах інтерферометра [1]. Не менш важливим є врахування розподілу фази в рентгенівських пучках, які інтерферують в аналізаторі інтерферометра. Тому дослідження впливу різноманітних факторів на формування муарових зображень є практично важливим завданням.

Мета даної роботи полягала в теоретичному дослідженні закономірностей і механізмів формування інтерферометричних зображень дефектів в реальних кристалах.

Розглянемо принцип моделювання рентгенівських інтерферограм, який полягає у знаходженні комплексних амплітуд заломленої і дифрагрованої хвиль у кожній точці кристалу. Рентгенівські промені спочатку проходять через розчеплювач S , потім по двох шляхах через дзеркало M та інтерферують в аналізаторі A . При цьому принципове значення має різниця фаз, з якими інтерферуючі хвилі приходять на поверхню кристалу-аналізатора. Знаючи її та зміну періодів муарових смуг, можна досліджувати вплив тих чи інших

факторів на формування інтерферометричного поля.

Для спрощення розрахунків можна вважати, що після проходження перших пластинок в третьому кристалі аналізаторі накладаються тільки дві плоскі, когерентні хвилі однакової інтенсивності. Тоді муарова картина виникатиме при наступній суперпозиції амплітуд [2]:

$$I_M^I = E_{oh}^I E_{oh}^{I*} = (E_o^I + E_h^I)(E_o^{I*} + E_h^{I*}) \quad (1)$$

$$I_M^{II} = E_{oh}^{II} E_{oh}^{II*} = (E_o^{II} + E_h^{II})(E_o^{II*} + E_h^{II*}) \quad (2)$$

Врахуємо те, що в слабо деформованих кристалах амплітуди хвильових полів є повільно змінними і формування муарової картини пов'язано, в основному, із фазовою невідповідністю інтерферуючих в аналізаторі хвильових полів. Це дає змогу використати ейкональне наближення теорії Като [3]. В даній теорії вектор дифракції є функцією просторових координат і відіграє роль повільно змінного показника заломлення в оптиці. В оптиці для середовищ з плавно змінними характеристиками неоднорідностей широко використовується так зване хвильове наближення (розмір неоднорідності L повинен значно перевищувати довжину хвилі λ). В рентгенівському випадку такий критерій має дещо жорсткіші границі. Тут необхідно, щоб $L > \Lambda$, де Λ - екстинкційна довжина. Такий підхід дає змогу виділити в амплітудах E_o і E_h швидко змінні фазові множники:

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_o \\ E_h \end{pmatrix} = e^{iS^+(x,z)} \mathbf{F}^+(x,z) + e^{iS^-(x,z)} \mathbf{F}^-(x,z), \quad (3)$$

де S^+ і S^- два ейконала (фази), які відповідають двом різним листам дисперсійної поверхні, перший з яких пов'язаний з сильним поглинанням випромінювання, а другий - з слабким [3].

Моделюванні картин муару проводилось для загального випадку, коли поле зміщень дефекту складним чином залежить від координат. Для знаходження комплексних амплітуд хвиль на виході з аналізатора можуть бути використані так звані рівняння Такагі для

опису розповсюдження рентгенівських променів у деформованому кристалі [3]:

$$(D_s + D)\mathbf{E} = 0. \quad (4)$$

Існування нетривіального нульового розв'язку рівняння $D_s \psi = 0$ вимагає, щоб детермінант матриці D_s був рівний нулю, тобто

$$D_s = \begin{pmatrix} -\left(\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial S}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\chi_h C \\ \frac{1}{2}\chi_h C & \left(\frac{\partial S}{\partial x} - \frac{\partial S}{\partial z}\right) - 2\alpha(\mathbf{r}) \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} i\left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial x}\right) & 0 \\ 0 & i\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\right) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

В розгорнутому вигляді ця умова для ейконалів S^+ і S^- є рівнянням в частинних похідних першого порядку:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial z} + \alpha(\mathbf{r})\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial x} - \alpha(\mathbf{r})\right)^2 = \tilde{\chi}^2, \quad (6)$$

де $\tilde{\chi} = \frac{1}{2}|C|(\chi_h \chi_h^-)$, $\alpha(\mathbf{r}) = \alpha_0 - 2\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{2H\mathbf{u}}\right)$, α_0 характеризує розорієнтацію кристалу як цілого, \mathbf{H} - вектор дифракції, \mathbf{u} - векторне поле зміщень.

Рівняння (6) аналогічне одномірному релятивістському рівнянню Гамільтона-Якобі для частки масою $\pm\tilde{\chi}$ в деякому змінному зовнішньому полі. Відмінність полягає в тому, що в (5) цей коефіцієнт комплексний $\tilde{\chi} = \chi - i\gamma$ і, як наслідок, траєкторії і ейконал також є комплексними. Фізично це пов'язано із затуханням хвильового поля в кристалі. У випадку довільних χ і γ рівняння (6) представляють собою систему двох нелінійних рівнянь відносно

дійсної і уявної частини ейконала $S = s + iq$. Обставина, що для рентгенівських хвиль $s > q$, дозволяє вважати уявну ейкональну частину малою в порівнянні з її дійсною частиною. Використовуючи загальний метод теорії наближень і опускаючи громіздкі проміжні викладки, отримуємо рівняння, які дозволяють однозначно визначити в нульовому і першому наближенні зміну амплітуди поля вздовж траєкторії, якщо відомі початкові значення E_0 і E_h на вхідній поверхні кристалу:

$$\mathfrak{E} \approx \sum_{\delta=1,2} e^{\frac{i\chi_h}{2} S^{(\delta)}} (\mathfrak{E}^{(\delta,0)} + \mathfrak{E}^{(\delta,1)})$$

$$E_0 = e^{i\left(\frac{c_h - a}{2} - \frac{a}{4}\right)} \left[\frac{1}{2} + \frac{i}{4\chi_h} P_1(\alpha, z) \right] + e^{-i\left(\frac{c_h + a}{2} + \frac{a}{4}\right)} \left[\frac{1}{2} - \frac{i}{4\chi_h} P_1(\alpha, z) \right] +$$

$$+ e^{i\left(\frac{c_h - a}{2} - \frac{a}{4}\right)} \frac{P_2(\alpha, z)}{0.5i\chi_h} - e^{-i\left(\frac{c_h + a}{2} + \frac{a}{4}\right)} \frac{P_2(a, z)}{0.5ic_h};$$

$$E_h = e^{i\left(\frac{c_h - a}{2} - \frac{a}{4}\right)} \left[\frac{1}{2} + \frac{i}{4c_h} P_1(a, z) \right] - e^{-i\left(\frac{c_h + a}{2} + \frac{a}{4}\right)} \left[\frac{1}{2} - \frac{i}{4c_h} P_1(a, z) \right],$$

де

$$P_1(a, z) = \frac{a^2}{8} + a'_x z \left(\frac{az}{8} + \frac{a'_x z^2}{24} + i \right) + \frac{ia''_{xx} z^2}{4},$$

$$P_2(a, z) = \frac{i}{4} (a + a'_x z) \quad (10)$$

Зауважимо, що перша складова рівняння (10) відповідає зображенню електронного мікроскопу, друга і третя складові, відповідно, відхиленню і фокусуванню (дефокусуванню) променів при їх проходженні через середовище зі змінним показником заломлення.

В загальному випадку, коли поле зміщень дефекту складним

чином залежить від координат, фаза, що набігає по одному з шляхів розповсюдження, визначається функцією локальних розорієнтацій, яка не володіє парністю щодо зміни напрямку вектора дифракції.

Таким чином, підставляючи формули (8) і (9) у співвідношення (1) і (2) з врахуванням (10) і (11) отримуємо можливість моделювання інтерферометричних зображень дефектів в аналізаторі трьохкристального рентгенівського інтерферометра.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика.- М.: Наука, 1982.- 390 с.
2. Takagi S. A dynamical theory of diffraction for a distorted crystals // Phys.Stat.Sol.-1969.-**26**, N5.-P.1239-1253.
3. Kato N. A Theoretical Study of Pendellosung Fringes. PartII. Detailed Discussion Based Upon a Spherical Wave Theory // Acta crystallogr.- 1961.- **14**, part 6.- P.627-636.

SUMMARY

RARANSKY M.D., FODCHUK I.M., BOBROVNIC S.V.

SIMULATING X-RAY MUAR DEFECT'S IMAGES IN Si

Main moments of the theory of formation of the muar defect's images in three crystal interferometry are submitted. The eikonal two-wave approximation is used. It is assumed that diffraction is a function of space coordinates and plays a role of a slowly varied refraction parameter in optics.